

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

portion that is located near the one surface of the substrate and has an opening. The ratio of the diameter dimension of the opening in the shielding portion to the diameter dimension of the plasma, which is generated by the plasma generating unit, in the direction along the one surface of the substrate is set in the range of 110/100 or less.

(57) 要約: 本発明の薄膜製造装置は、密閉可能なチャンバ内を移動する基板の一面に成膜粒子を付着させて薄膜を成膜する装置であって、プラズマ発生部と、基板移動部と、成膜源供給部と、成膜領域規定部と、を有する。前記プラズマ発生部が、前記基板の他面側に位置するマグネットと、前記基板の一面近傍に成膜ガスを供給するガス供給部とを有する。前記成膜領域規定部が、前記基板の一面近傍に位置して開口を有する遮蔽部を有する。前記遮蔽部が、前記プラズマ発生部で発生させるプラズマの前記基板の一面に沿った方向における径寸法に対する、前記開口の径寸法の比が、 $110/100$ 以下の範囲に設定される。